FORM FTO-1449 (modified) To: U.S. Department of Commerce (PW FORM PAT-1449) Patent and Trademark Office							•	Attý: Dkt. No.				nt Rél		表情感到
		•		•	·	•			204000		三	240.6		332
NEODBIA.	TIO	a pieci centr	- от	ATERAL	FAIT			Applicant	304800 · VAN DER WER			<u>342.u</u>	10-US	
INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT BY APPLICANT Applicant: VAN DER WERF										\F∙ C t 6	11.			
		•						Appln. No	TO BE ASSIG	NED	 -			
79 79							_		e: July 14, 2003	•		•		_
Date: July 14, 2003 Page			'age	1	of	1]	Examiner		Gro	up Art l	Jnit:		
US PATEN	IT:D	OCUMENTS.		30 = 2					亚乌里 泽			100		
Examiner's		Document		Date		Name		•		Clas			Filing	
Initials*		Number		MM/YYYY		(Family Name		of First Inventor)		1	Cla	SS.	Date (if approp	
91	ÁR	4,613,230		09/1986		IWAI				-		_	(п арргор	nate)
2.1	BR	4,856,905		08/1989		NISHI		 -				=	. , is.	· ·
211	CR	6,142,641		1.1/2000		COHEN	et al.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·] _	\equiv			
2/1	DR	6,151,120		11/2000		MATSU	мото	et al.						
	ER									<u> </u>				
	FR	<u> </u>				<u> </u>		<u> </u>					<u> </u>	
	GR	ļ	<u>·</u>			 :				<u> </u>			1	
 	HR	ļ		ļ		<u> </u>	 -			 			ļ	
	IR_	- Carlo NCC-2/e-1gg; Table 18	*****************************		Pleased.	Pine la	and the same of the			- Carry Carr				
FOREIGNE	ATE		DOCUMENTS								English Abstract		Translati Readily	ion
		Document Number	Date MM/	• Y YYY [*]	Cou	ntry	Inven	ntor Name			·	Available		
NV	10	5-160001	06/1	202	JAP	ANI	14171	TAAH			Enclose	d No	Enclose	No
1	JR KR	5-100001	U6/1	993	JAF	AN	IVIIZU	ITANI			X	+	 	╄
	LR		 		 		+	 			 	+	 	╀╌
	MR	 	\vdash	:			+	· .			 	+-	 · · ·	╁╌
	NR		_		-		+-	·	·	1	 	+-	 	十
	OR		<u> </u>	· · · ·	<u> </u>		+	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			<u> </u>	+-	 	┿
	PR	<u> </u>	\vdash				+	····	·			+	 	\vdash
	QR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	\vdash				1	· :		-	ļ ———	+	 	1.
	RR					•	 					+	 	\vdash
	SR			-			1	·				 	 	\vdash
		o in this order Au	thor	Title P	eriod	ical Nam	e Date	Reitinen	t-Pages (etc.)			†	 	十
	TR	g in this order Author, it itle, Periodical Name Date, Pertinent Pages, etc.) Chaudhuri et al., "Alignment of a multilayer-coated imaging system using extreme ultraviolet Foucault and Ronchi interferometric testing," J. Vac. Sci. Technol. B 13(6):3089-3093 (1995), XP 000558379											-	
K	UR	Vaidya et al., "Extreme Ultraviolet Lithography for 0.1 µm Devices," VLSI Technology, Systems and Applications, 1999. International Symposium on Taipei, Taiwan, 8-10 June 1999, Piscataway, NJ, pp. 127-130, XP 10347511												
	VR					·						1		
	WR				<u>.</u>							1_		<u> </u>
	XR						* .		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		, .			
	YR		::											
	ZR		- ,									\prod		
المصا	AAR											Ι		
Examiner	/	315 1	7	Z_	\equiv			Date Cons	sidered: //	2/	04.			
*EXAMINER		nitial if citation cons and not considere	sidere	d, wheth	ier or	not citation	on is in o	conformanc	e with MPEP § 609). Drav	w line th	rough	citation i	f